

B. Patterning 분과

Room D
창의관 (117)

일 시 : 2월 17일(금) 09:30-11:00

세션명 : [FD1-B] Patterning (Litho & Etch)

좌 장 : 유원종(성균관대학교)

FD1-B-1 09:30-09:45 Modeling and Simulation of Line Edge and Width Roughness for EUV Resists

저자: Sang-Kon Kim

소속: Department of Applied Physics, Hanyang University

FD1-B-2 09:45-10:00 Analysis of Etched Biases of a Continuous Lines and Spaces for Patterning for Deep Trench Isolation

저자: Hee-Young Koh, YongKuk Bae, Siyoung Choi, and Yun-Suk Nam

소속: Process Development Team, Semiconductor R&D Center, Samsung Electronics Co., Ltd.

FD1-B-3 10:00-10:15 Analysis of Overlay Error by Different Aperture Mixing at 2Xnm Node

저자: 김신영, 박찬하, 양현조, 임동규

소속: Hynix반도체 노광OPC팀

FD1-B-4 10:15-10:45 **[Invited]**플라즈마 처리에 의한 그래핀의 전기적 특성 제어

저자: 유원종

소속: 성균관대학교 나노과학기술원